⑩ 公開特許公報(A) 昭62-80644

၍Int_Cl.⁴	識別記号	庁内整理番号		43公開	昭和62年(198	7)4月14日
G 03 C 5/24 G 02 B 5/20	3 2 1	7267-2H 7529-2H				
G 03 C 1/68 G 03 F 7/00	3 4 1	7267-2H 7124-2H	審査請求	未請求	発明の数 1	(全7頁)

②特 願 昭60-221162

郊出 願 昭60(1985)10月4日

⑫発	明	者	Ξ	浦	近	衛	横浜市緑区鴨志田町1000番地	三菱化成工業株式会社総合
⑦発	明	者	落	合	為		研究所内 横浜市緑区鴨志田町1000番地	三菱化成工業株式会社総合
79発	88	去	牧	鳥	秀	夫	研究所内 横浜市緑区鴨志田町1000番地	三菱化成工業株式会社総合
(9)1	2/3	43	- 1	<i>a</i>	7.7		研究所内	

①出 願 人 三菱化成工業株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号

羽代 理 人 弁理士 長谷川 一 外1名

明 細 書

- / 発明の名称 リンス液
- 2 特許請求の範囲
 - (1) 構成要素としてエポキシ基を含む感光性ポリマーのリンス液であつて pKa が 3.0 以下の でなくとも フロトン酸もしくは下記ルイス酸の 一種を含むことを特徴とするリンス液。

ルイス酸: BF, . BC1, もしくはそれ等の錯体

(2) リンスする 感光性ポリマーが少くともくり 返し単位式(1)を含むことを特徴とする特許請求の範囲第/項記載のリンス液。

(3) リンスする感光性ポリマーが近紫外、可視

領域まで感度を持つ感光基及びくり返し単位 (I)を含むことを特徴とする特許請求の範囲第 2項記載のリンス液。

(4) 感光差が式(II)、(III)、(IV)から選択される少な くとも / 種であることを特徴とする特許請求 の範囲第3項記載のリンス液。

(式中、 Pは水素原子又はメチル基を表し、 Pは水素原子又はフェニル基を表し、 Pは水素原子、フェニル基又はシアノ基を表し、 Pをよびでは水素原子、ハロゲン原子、ニトロ

基又はメトキシ基を表す。)

R', R'は水素原子又はメチル基を表す。

3 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、有機カラーフイルターの耐染色性 層等として良好に使用し得る感光性ポリマーに 用いるリンス液に関する。ここに感光性ポリマ - とはディーブ uv 光から可視光までに感度を 有するポリマーを指す。

「従来の技術」

カラーフィルターの塔載方法には大別して次

て染色層を形成後レジストを剝離し、その後 に同様にして次の染色層を形成する。(単一 の被染色層を複数の染色部分に染め分ける方 法。)

② 被染色層を所定のパターンに露光し、現像 した後染色して染色層を形成し、次いで、透明な耐染色性絶縁層を被覆後、その上に同様 にして次の染色層を形成する。

上記①の方法は、各染色部分の境界における 色のにじみ等の問題があり、一般には②の方法 が広く行われている。

上記②の方法で得られるカラーフイルターにおいては、耐染色性絶縁層の選択が重要である。

耐染色性絶縁層は、第2色目以降の染色の際に、既に染色された第1色目の染色層の耐染色層としての役割と、出来上つたカラーフイルターの染色層間の経時的な色のにじみを防止するという重要な役割を持つている。また、耐染を性絶縁層は、基本的に、耐染色性、基板及び染色層との接着性、無色透明性、耐現像性、塗膜

のよつがあげられる。

- ① 例えば、シリコンウエーハー等の上に光検 知部等を設けてなる固体操像素子上に直接色 分解有機カラーフイルターを製造するもの (以下「直付型」と云う)。
- ② 固体機像案子と色分解有機カラーフイルターを夫々個別に製造しておき、両者を位置合わせしつつ、適当な接着剤等で貼合せるもの(以下「貼合せ型」と云う)。

本発明のリンス液は量産性に優れていると考 えられる直付型カラーフィルターに適用するの が毎に有用である。

直付型カラーフイルターを製造する場合、通常、固体機像素子の表面を平坦化し、ひずみのないカラーフイルターを得るためにポリマー層(以後「平坦化」層と呼ぶ)を塗布する。その後その上に被染色層を形成するための感光性物質層をもうけ、しかる後に、

① 被染色層上にパターニングしたレジストを 設け、第出している被染色層の部分を染色し

性が良好であるととが必要とされる。

さらに直付型のカラーフイルターの場合もででである。 ラーカのは、カラーに直接機会とでは、からでは、カラーには、耐楽色性絶縁層のののでは、、所謂がング・パッド部のの形では、ない。とは、でいるのではなった。とは、では、ないのでは、できる。

とのような目的に合う感光性樹脂として分子 内にエポキン基を導入して密着力の心にとれたとればポリグリンートもしくはそれと他のモノマンプレート、メチルイソンシスをにより、アンキャン等との共重合体、又はレーダ、メチンとステルメンタとの共重合体あるいたと、といるとの共重合体を持つたとして、アンドで表面である。 単位を含むものたとえばグリシジルメタクリレートとシンナモイルオキシエチルメタクリレート、メタクロイロキシカルコンもしくはそれらの誘導体との共重合体が好適に用いられる。 〔発明が解決しようとする問題点〕

本発明者等は以上のような点に鑑み、鋭意検討を進めた結果、該感光性ポリマーをパターン ののでは、では、でリンスを行い しかる後に熱硬化を行えば染色層の劣化をきた さない比較的低温で熱硬化することができ、ひいては密着性を著しく向上させ得ることを見出

ル等のエーテル系容媒、アセトニトリル、ペン ゾニトリル等のニトリル系裕族等が単独又は 2 種以上の混合液として好適に用いられる。これ に pKa が 3.0 以下のプロトン酸もしくは三フツ 化ホウ素又はその錯体、三塩化ホウ素又はその 錯体等のルイス酸を 0.1 多~ 2 0 多、好ましく は0.5~10多の範囲に搭解させてリンス液と する。 pKa が 3.0 以下のプロトン酸としては、 たとえばフルオル酢酸、クロロ酢酸、トリフル オル酢酸、トリクロロ酢酸、ニトロ酢酸等のカ ルポン酸、ペンゼンスルホン酸、p-トルエン スルホン敵等のスルホン酸、硫酸等の鉱酸が好 適に用いられる。 pKa がこれより低い場合は充 分なる効果が得られない。また該酸の排点は / 20℃以上好ましくは / 40℃以上のものが 好適に用いられる。沸点が低すぎると熱硬化時 に逃散してしまい充分な効果を得るととが出来 左いり

以下本発明のリンス液を用いたカラーフイル ターの一例につき図面を用いて更に詳細に説明 し本発明を完成した。

すなわち本発明の要旨は、構成要素としてエポキシ基を含む感光性ポリマーのリンス液であって pKa が J. O 以下のプロトン酸もしくは下記ルイス酸の一種を含むことを特徴とするリンス液に存する。

ルイス酸: BF,,BC1,もしくはそれ等の錯体

本発明をさらに詳しく説明する。リンスマールを 主名解成変素としなばアセルケトン、 食溶が望ましくたとえばアチルケトン、 を変素とれてイソプチルケトン、 を変素とれてイソプチルケトン、 を変素が多さいた。 がリンステルケトン、 を変素が多さいた。 がリンステムでは、 でいたができなが、 でいたが、 でいが、 でいたが、 でいが、 でいたが、 でいたが、 でいたが、 でいたが、 でいたが、 でいたが、 でいなが、 でいたが、 で

する。

第 / 図(a) ~ (d) は直付型カラーフイルターの製造工程の一例を示す説明図である。

図中/はシリコンウエハー、2は光検知部、3は保護膜、4は平坦化層、5は被染色層、6はマスク、7は耐染色性絶縁層、8はポンデイング・パッド、9は被染色層、10は表面層、をそれぞれ示す。

直付型カラーフイルターの場合は固体操像素子面上に直接カラーフイルターが設けられるものであり、その基体となる固体操像素子は例えば第/図(a)に示すようなシリコンウェハー/に光検知部ュが設けられ、その上面にリンガラス、石英等の保護膜ェが設けられた構造とされている。固体操像素子にはその他、走査線、選光膜等が設けられているが、図面には省略した。

本発明のカラーフイルターは上述のような固体撮像索子の上面に形成するものでありその工程順に説明する。

まず固体機像案子の保護膜3の上に0.2~

2.0 単程度の厚さに平坦化層 4 を被覆する。 この平坦化層は後述する耐染色性絶縁層 7 と同じものを使用するのが良い。この層によつて光検知部の表面が平坦化され、被染色層 5 、耐染色性絶縁層 7 等の形成が容易となり、また被染色層 5 の厚みむら等に恭づく色のヒズミ等が軽減される。次いでこの平坦化層 4 上に所定のポンデイングパッド 8 等を加工する {第/図(b)}。

この平坦化層 4 の材質、ポンデイングパッド 8 の加工方法については後に耐染色性絶縁層 7 の説明と合せて詳細に述べる。

次いで平坦化層 4 上にゼラチン、カゼイン、 グリユー、アルブミン等、或いは、ポリビニル アルコール等の合成ポリマー等の水溶性ポリマ - と重クロム酸アンモニウム等の重クロム酸塩 との混合物を塗布して被染色層 5 を構成するた めの感光性物質層を形成する (第 / 図(c))。

被染色層 5 を構成するための感光性物質層は、 通常、厚さ 0.1~ 2 μ となるように設ける。

次いで、被染色層 5 を構成するための感光性

水銀燈等を用いれば良い。

次いで、該耐染色性絶縁層ヶ上に、前述と同様にして被染色層を構成するための感光性物質を設け、露光、現像して所定のパターンの被染色層部分を形成する。そして、所定の分光特性を有する第2色目の染料で染色して第2の被染

物質層上に所定のバターンを有するマスク6を通して露光する{第/図(d)}。被染色層 5 を構成するための感光性物質には、通常、 4 4 0 ~ 3 8 0 nmに感光性をもたせるようにするので、かかる領域の波長を有する高圧水銀燈等を光源として露光する。

次いで、水で現像して所定のパターンの被染色層 5 を構成する部分を形成し(第/図(e))、 所定の分光特性を有する第/色目の染料で公知 の方法に従い染色して被染色層 5 を形成する。

次いで、耐染色性絶縁層 ? を形成するための感光性樹脂組成物を被覆する { 第 / 図(ば) } 。本発明においては、耐染色性絶縁層 ? の形成の心は、耐染色性絶縁層 ? の形成の心とする感光性組成物を被染色層 * を形成した上に塗布し { 第 / 図(ば) } 、所定のバターン なる部分をある。ボンディング・バッド部を形成するるである。ボンディング・バッドのを形成する。 第 / 図(に) } 。 露光に当っては該感光性組成物が吸収を持つ波長の高圧

色層 9 を形成する (第/図(1))。

かかる操作を繰返し、耐染色性絶縁層を介して更に他の被染色層を形成してもよい。

被染色層としては、赤、緑、青の三原色系の 3種を用いることもあれば、シアン、緑、黄の 補色系の3種を用いることもある。その際、例 えば、第1のシアンの被染色層に、第2の黄の 被染色層を一部重なるように形成して、その重 なり部分で第3色目の緑色を得るようにしても よい。

通常、最上部の被染色層上に、表面の平滑化、 或いは染色層の保護のために表面層 / 0 を設ける。

表面層 / 0 も前述の感光性組成物を使用し、本発明のリンス液を使用し熱硬化させるのが良い。

表面層 / のは通常 の / ~ 2 μ の膜厚となるように設けさらに露光現像して所定のポンディング・パットなどの加工を行なり(第 / 図(d) }。

以上のよりにして、本発明のカラーフィルタ

- を得ることが出来るが、本発明のリンス液を用いることによりきわめて強固で密着力のすぐれた透明ポリマー層を得ることが出来超音波洗净等の苛酷な条件下でもはくりがおこることがない。

〔寒施例〕 ·

以下実施例により本発明を更に具体的に説明する。

奥施例/~9

前記式の「と」に相当するモノマーをジオキサンラジカル重合して得られた感光性樹脂をシクロヘキサノンに / 3.0 wtがとなるように溶解し、更に次式に示す増感剤を感光性樹脂に対して /.0 wtが添加し感光性組成物を作成する。

次に作成した感光性組成物をシリコン基板上 に膜厚が 1.0 μとなるようにスピンコーテイン グ塗布して樹脂層を形成した。 この樹脂層に高圧水銀煙が装備されたマスクアライナー MA/O (ミカサ㈱製)を用いて300ミリジュール/cd のエネルギー量で露光した後20℃のメチルイソプチルケトンとイソプロピルアルコールの 1:/(vol/vol)温合容液で1分間スプレー現像した。更に酸成分含有のメチルイソプチルケトン溶液で1分間スプレーリンスを行いた。さらに150℃で15分間ポストベークを行い熱キュアした。

ついで、FTIRによりグリンジル基のピーク (902nm)の減少によりグリンジル基の減少量 を決定した。

評価結果を表/に示す。

比較例 / ~ 3

リンス液の組成を表 / に示す通りとしたほか 実施例 / と同様にして行つた。

結果を表/にまとめる。

表 -	1
-----	---

寒 施 例	リンス液	PKa	酸成分の濃度	グリシジル基残存量(%)	俤	考
爽施例 /	сс1,соон + мівк	0.635(250)	/.0 wt%	8	* # 1 =	- /
, 2	CC1,COOH + MIBK	•	/0.0 wt%	5	ポリマ	- /
* 3	ссі,соон + мівк		J.0 wt%	,	ポリマ	_ 2
, 4	сс1,000н + мівк		3.0 #t%	o	ポリマ	- 2
, 5	p-トルエンスルホン酸 + M I B K		/.0 wt%	29	ਸ਼ੀ ਮੁਤ	- /
, 6	p - トルエンスルホン酸 + M I B K	,	10.0 wt%	o	ポリ マ	- /
. 7	pートルエンスルホン酸+ M I B K	,	3.0 wt%	. 0	ऋ ग च	- 2
, 8	pートルエンスルホン酸+MIBK	,	5.0 wt%	0	ポリマ	- 2
s 9	BF,O(C,H,), + MIBK	-	5.0 Wt%	10	तरं ।) चरः	- /
比較例 /	мівкод	-	_	100	ਸ਼ੀ ਮੁਤਾ	- /
. 2	酪酸 + MIBK	4.82 (25C)	10.0 wt%	90	ポリマ	- /
, 3	安息香酸 + MIBK	4.2 (25C)	/6.7 wt%	100	ポリマ	- /

* ポリマー/及び2は次の組成比で得られたものである 前記式 IとⅡの割合

I / I (₹ν%/₹ν%) 7 ap/C

ポリマー/ 50 / 50

ポリマー2 65 / 35

寒施例 / 0

多数の光検知部とこれらを駆動する駆動回路 とからなる固体機像素子基板上に、実施例/と 同様に作成した感光性組成物を膜厚が2μとな るよりにスピンコーティング塗布して、平坦化 層を形成するための樹脂層を形成した。途布し た樹脂層は黄色みを帯びていた。この平坦化層 を形成する樹脂層にポンデイング・パッド等の 所定のパターンを有するマスクを通して、高圧 水銀燈が装備されたマスクアライナーMAIO 型「ミカサ㈱製】を用いる00ミリジュール/ alのエネルギー最で露光した後20℃のメチル イソプチルケトンとイソプロピルアルコールの 7: / (vol/vol) 混合溶媒で/分間スプレー 現像した。さらにちwt%トリクロロ酢酸含有メ チルイソプチルケトンで1分間リンスを行つた。 さらにホットプレート上で150℃ょ分間ポス トベークを行つた。得られたポンデイング・パ ッド部などの加工がなされた平坦化層は、黄色 みが消え透明な層であつた。

リンス、無キュアして透明でかつポンデイング・パッド部などの加工がなされた耐染色性絶縁層を形成した。

次いで、この耐染色性絶縁層上に、前述と同様にしてゼラチン一重クロム酸アンモニウム層を形成し、前述と同様に露光、現像した後、酢酸で pH を 4 に調整した " ダイアクロンターキスプルーG P " (三菱化成工業㈱の登録商標) の約 0.3 多水溶液で 7 5 C、/分間染色処理して被染色層を形成した。

次いで、保護膜として平坦化層と同じ感光性 組成物を膜厚のよりとなるようにスピンコーテイングにより強布して前記と同様の条件にて舞 光、現像してポンデイング・パッド部等の加工 のなされた透明な表面層を形成しカラーフイル ターが直付された固体カラー摄像素子を得たの との撮像衆子を超音波洗浄にかけても膜はがれ は認められなかつた。

比 較 例 4

ついで/s0℃で/s分間ポストペークを行い熱キュアした。

次いでこの平坦化層上にゼラチンー重クロムでアンモニウム(10:1、重量比)の水溶液を膜厚が1μとなるようにスピンコーテイングにより塗布して被染色層を形成する感光性物質層を形成した。この被染色層を形成するマスクを衝質層に、所定のパターンを有するマスクを通して前記と同じ装置を開いよりのより、45℃で1分間現像した。次いで120℃で15分加熱してゼラチン膜を硬化させた。

酢酸で pH を 4 に調整した "カヤノールイエローN 5 G" (日本化薬(物製) (カヤノールは日本化薬(物の商品名) の約 0./ 多水溶液中に 7 5 C、/分間浸漬し染色処理して被染色層を形成した。

次いで平坦化層と同じ組成の感光性組成物を 膜厚が 0.5 μ となるようにスピンコーテイング 塗布し、平坦化層の場合と同様に繋光、現像、

リンス液として MIBK のみを用いるほかは実施例 2 と全く同様にして固体カラー撮像素子を作製した後超音波洗浄を行うと膜はがれが認められた。

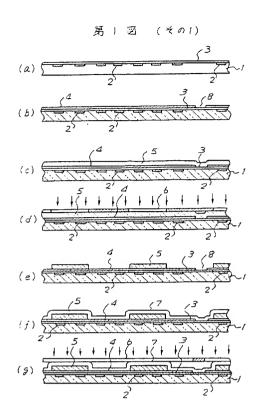
[発明の効果]

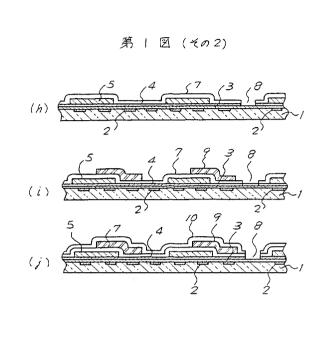
このように本発明のリンス液でリンスした後 熱キュアすれば基板及び染色層との接着性にす ぐれ苛酷な条件においても膜はがれ等の劣化を おこさない耐染色性絶縁層を形成することがで きる。

4 図面の簡単な説明

第 / 図(a) ~ (j) は直付型カラーフイルターの製造工程の一例を示す説明図である。

図中/はシリコンウエハー、2は光検知部、3は保護膜、4は平坦化層、5は被染色層、6はマスク、7は耐染色性絶緑層、8はポンデイング・パッド、9は被染色層、10は表面層を表す。





PAT-NO: JP362080644A

DOCUMENT- JP 62080644 A

IDENTIFIER:

TITLE: RINSING SOLUTION

PUBN-DATE: April 14, 1987

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

MIURA, KONOE

OCHIAI, TAMEICHI

MAKISHIMA, HIDEO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

MITSUBISHI CHEM IND LTD N/A

APPL-NO: JP60221162

APPL-DATE: October 4, 1985

INT-CL (IPC): G03C005/24 ,
G02B005/20 ,
G03C001/68 ,
G03F007/00

US-CL-CURRENT: 264/1.1

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the adhesion of a rinsing soln. for a photosensitive polymer having epoxy groups by adding a protonic acid or Lewis acid having ≤3.0pKa to the rinsing soln.

CONSTITUTION: This rinsing soln. for a photosensitive polymer having epoxy groups contains a protonic acid or Lewis acid having ≤3.0pKa. The Lewis acid is BF3, BCl3 or a complex thereof. The preferred principal constituent of the rinsing soln. is a bad solvent for the photopolymer and acetone is suitable for use as the solvent. Fluoroacetic acid is suitable for use as the protonic acid having ≤3.0pKa. When the acid has

>3.0pKa, a significant effect is not produced. The preferred b.p. of the acid is ≥140°C. When the b.p. is excessively low, the acid evaporates during heat curing, so a significant effect can not be produced.

COPYRIGHT: (C) 1987, JPO&Japio